

ABSTRAK

Telah dilakukan deposisi lapisan tipis SnO_2 (Timah dioksida) sistem larik pada substrat kaca menggunakan *Sputtering DC* untuk aplikasi sensor gas. Dalam penelitian ini, parameter yang divariasi adalah waktu deposisi dimulai dari 1 jam, 2 jam dan 3 jam, serta variasi suhu deposisi dimulai dari 150°C, 200°C, 250°C dan 300°C dengan tegangan tinggi DC sebesar 2.2 kV dan tekanan kerja 3×10^{-2} torr. Nilai resistansi terkecil yaitu sebesar $39 \text{ M}\Omega$ diperoleh pada kondisi waktu deposisi 3 jam dan suhu 150°C, sedangkan temperatur kerja dari lapisan tipis SnO_2 sistem larik adalah antara 260°-330°C. Respon sensor SnO_2 terhadap gas menunjukkan bahwa CH_3COCH_3 (aseton), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (etanol) dan NH_3 (amonia) termasuk gas reduktor sedangkan HNO_3 (asam nitrat) merupakan gas oksidator. Hasil juga menunjukkan bahwa sensor dengan sistem larik lebih sensitif dibanding sensor tunggal, walaupun sensor SnO_2 sistem 2 larik kurang sensitif untuk CH_3COCH_3 (aseton) dan NH_3 (amonia).

ABSTRACT

Deposition of SnO_2 (Tin Dioxide) thin film arrays system on glass substrate has been carried out using DC Sputtering for gas sensors application. In this research, varried parameters were time 1 hour, 2 hour and 3 hour, temperature deposition were 150°C , 200°C , 250°C and 300°C with DC Sputtering high voltage was 2.2 kV and working pressure 3×10^{-2} torr. The smallest resistance in order of $39 \text{ M}\Omega$ was achieved at time deposition 3 hour and temperature 150°C , while the working temperature of the SnO_2 thin films multyarrays system is $260^\circ\text{-}330^\circ\text{C}$. Respons SnO_2 sensors gas showed that CH_3COCH_3 (acetone), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (ethanol) dan NH_3 (ammonia) is a reductor gas while HNO_3 (nitric acid) is an oxidator gas type. The results also showed that the multyarrays sensor more sensitive than monosensor, although the two arrays SnO_2 sensor system less sensitive for CH_3COCH_3 (acetone) and NH_3 (ammonia).